



10/100

۸۷/۱/۱۰۸۳۱۷  
۰۸/۱/۲۹



دانشگاه شهید بهشتی  
دانشکده فیزیک

پایان نامه  
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک

عنوان:

رفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه هادیهای مغناطیسی

$Zn_{1-x} (TM)_x O$  ( $TM=Mn, Fe, Co$ )

دانشجو:

آمنه رضایی حقدوست

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی طهرانچی

مهر ۱۳۸۷

دانشگاه شهید بهشتی  
دانشکده فیزیک

۱۳۸۸/۱/۱۸

۱۱۵۲۵۵

دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ .....  
شماره .....  
پیوست .....

بسمه تعالیٰ

«صورتجلسه دفاع پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد»

تهران ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ اوین

تلفن: ۰۹۹۰۱

بازگشت به مجوز دفاع شماره ۴۰/۹۱/۲۷/۱۳۸۷/۷ مورخ ۰۰/۰۷/۱۳۸۷ جلسه هیأت داوران ارزیابی پایان نامه خانم آمنه رضای حقدوست به شماره شناسنامه ۱۱۲۸ صادره از اصفهان متولد ۱۳۶۰ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک - حالت جامد

با عنوان:

(M = Fe و Mn) Zn<sub>1-x</sub> M<sub>x</sub>O<sub>2</sub> و Co<sub>x</sub>

به راهنمائی:

**دکتر محمد مهدی طهرانچی**

طبق دعوت قبلی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۰ تشکیل گردید و براساس رأی هیأت داوری و با عنایت به ماده ۲۰ آئین نامه کارشناسی ارشد مورخ ۰۵/۱۰/۲۵ پایان نامه مذبور با نمره ۱۸/۵ و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

۱- استاد راهنما: آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی

۲- استاد مشاور: -----

۳- استاد داور: آقای دکتر علیرضا صفارزاده

۴- استاد داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر سرمهین خرازی

۵- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده: آقای دکتر خسرو جدیدی

## تقدیم به :

پدر و مادر مهربانم،  
همسر خوبم شهرام ،  
دختر قشنگم نائیریکا،  
شیما و محمد عزیزم

## تشکر و قدردانی:

از خانواده عزیزم به خاطر حمایتهای بی دریغشان کمال سپاسگزاری را دارم و از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر طهرانچی بواسطه زحمات و راهنمایی هایشان قدردانی می نمایم

از دکتر قناعت شعار به جهت زحمات ایشان سپاسگذاری می نمایم.

از دوستان خوبم، خانم شیما نظری و خانم شیده امیریگانه و همچنین آقای حمید افتخاری که در مراحل انجام این پایان نامه از راهنمایی هایشان بهره برده ام ، کمال تشکر را دارم

از آقای علی رسولی که در انجام این پایان نامه مرا یاری نموده اند سپاسگذارم.  
در پایان از تمامی دوستان عزیز و ارجمندم در آزمایشگاه مگنتو اپتیک و پژوهشکده لیزر و پلاسما و تمام کسانی که به نحوی در انجام این پروژه با اینجانب همکاری داشته اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

## چکیده

نیم رساناهای مغناطیسی رقیق شده اکسید پایه، از نقطه نظر فرومغناطیس ذاتی ناشی از ورود یونهای عناصر انتقالی به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه بر هم کنش های مغناطیسی در  $ZnO$  و  $CO$  وارد شده در  $FeMn$  بر پایه تئوری تابعی چگالی،  $DFT$ ، با تقریب گرادیان تعمیم یافته،  $GGA$ ، مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات نشان می دهد  $ZnO$  ای که در آن  $Fe$  وارد نماییم دارای نظم فرومغناطیسی با خواص فلزی و  $Mn$  و  $CO$  وارد نماییم در حالت نیم رسانای فرومغناطیسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: گاف نواری، تئوری تابعی چگالی، تقریب گرادیان تعمیم یافته، نرم افزار Wien2k

## فهرست مطالب

۱۱.....	پیشگفتار
فصل اول - مقدمه	
۱۴ .....	۱-۱ اکسیدهای رسانای شفاف
۱۷.....	۱-۱-۱ اکسید رسانای شفاف با ترکیبات دوتایی
۱۸.....	۲-۱ اکسید روی (ZnO)
۱۸.....	۱-۲-۱ کاربردهای اکسید روی
۲۰.....	۱-۲-۲ خواص شیمیایی اکسید روی
۲۱.....	۱-۲-۳ ویژگی های عمومی اکسید روی
۲۵.....	۱-۴-۱ وضعیت جهانی اکسید روی
۲۶.....	۱-۵-۲ خواص الکتریکی فیلم های اکسید روی
۲۷.....	۱-۶-۲ خواص الکتریکی فیلم های اکسید روی آلاش شده
۲۷.....	۱-۷-۲ خواص نوری اکسید روی
۲۹.....	۱-۸-۲ خواص نوری غیر خطی اکسید روی
۲۹.....	۱-۳-۱ نیم رساناهای مغناطیسی رقیق (DMS)
فصل دوم- مروری بر رهیافت‌های نظری در فیزیک ماده چگال	
۳۳.....	۱-۲ واحد اتمی
۳۴.....	۲-۲ روش های حل مسائل بس ذره ای
۳۵.....	۱-۲-۱ تقریب بورن-اپنهایمر
۳۶.....	۱-۲-۲ نظریه هارتی-فولک
۴۰.....	۱-۲-۳-۲ گاز الکترونی همگن
۴۲.....	۱-۲-۴-۲ نظریه تابعی چگالی
۵۰.....	۱-۳-۲ پذیرفتاری فلزات، پارامغناطیس پائولی

## فصل سوم- بکارگیری نرم افزار Wien2k

۱-۳ اطلاعات مورد نیاز در مورد ساختارها.....	۵۴
۲-۳ بکارگیری تقریب .....	۵۶
۳-۳ بهینه سازی مقدار $R_{mt}$ و $k_{max}$ های انتخابی.....	۵۶
۴-۳ افزودن ناخالصی در اکسید روی.....	۶۱
<b>فصل چهارم- محاسبات و نتایج</b>	
۴-۱ ساختار بلور، نمودار نوار انرژی و چگالی حالات اکسید روی خالص.....	۶۶
۴-۲ ساختار بلور، نمودار های نوار انرژی و چگالی حالات اکسید روی با حضور ناخالصی .....	۶۹
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات.....	۹۰
مراجع.....	۹۲

## فهرست شکل‌ها و جداول

جدول ۱-۱- خصوصیات اکسید روی	۲۰
شکل ۱-۱- ساختار بلور ورتزایت اکسید روی	۲۲
شکل ۱-۲- ساختار نواری ZnO	۲۳
جدول ۱-۲- مقایسه خواص ZnO و GaN	۲۵
جدول ۱-۳- قیمت برخی از گونه های اکسید روی	۲۵
جدول ۱-۴- قیمت اکسید روی با استاندارد ACS	۲۶
شکل ۱-۳- دمای کوری پیش بینی شده از تنوری برای مواد مختلف	۳۰
شکل ۱-۳- اطلاعات ساختاری ZnO	۳۶
شکل ۲-۱- گرادیان میدان الکتریکی EFG؛ به صورت تابعی از تعداد نقاط k	۵۷
شکل ۲-۲- انرژی کل ENE؛ به صورت تابعی از تعداد نقاط k	۵۸
شکل ۲-۳- گرادیان میدان الکتریکی EFG، به صورت تابعی از $R_{mt} k_{max}$	۵۸
شکل ۲-۴- فاصله بار بین دو تا چرخه آخر DIS ، به صورت تابعی از $R_{mt} k_{max}$	۵۹
شکل ۲-۵- انرژی کل ENE، به صورت تابعی از $R_{mt} k_{max}$	۵۹
شکل ۲-۶- انرژی فرمی FER، به صورت تابعی از $R_{mt} k_{max}$	۶۰
شکل ۲-۷- اطلاعات ساختاری ZnO:TM	۶۳
شکل ۴-۱- ساختار بلور ZnO خالص	۶۷
شکل ۴-۲- نمودار نوار انرژی ZnO خالص	۶۷
شکل ۴-۳-الف- نمودار چگالی حالات کل ZnO	۶۸
شکل ۴-۳-ب- نمودار چگالی حالات برای عنصر اکسیژن در ZnO	۶۸
شکل ۴-۳-ج- نمودار چگالی حالات برای عنصر روی در ZnO	۶۹
شکل ۴-۴- ساختار بلور ZnO با حضور ناخالصی	۷۰
شکل ۴-۵- ساختار باند اسپین بالا و پایین (الف) Fe(TM) <sub>x</sub> O <sub>1-x</sub> (TM=Mn, Co)	۷۱
شکل ۴-۶-الف- نمودارهای چگالی حالات کل برای اسپین بالا و پایین ZnO:Mn	۷۳

۷۴	..... شکل ۴-۶-ب- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر اکسیژن در $ZnO:Mn$
۷۶	..... شکل ۴-۶-ج- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر روی در $ZnO:Mn$
۷۸	..... شکل ۴-۶-د- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر منگنز در $ZnO:Mn$
۸۰	..... شکل ۴-۷-الف- نمودار های چگالی حالات کل برای اسپین بالا و پایین $ZnO:Fe$
۸۱	..... شکل ۴-۷-ب- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر اکسیژن در $ZnO:Fe$
۸۲	..... شکل ۴-۷-ج- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر روی در $ZnO:Fe$
۸۳	..... شکل ۴-۷-د- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر آهن در $ZnO:Fe$
۸۵	..... شکل ۴-۸-الف- نمودار های چگالی حالات کل برای اسپین بالا و پایین $ZnO:Co$
۸۶	..... شکل ۴-۸-ب- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر اکسیژن در $ZnO:Co$
۸۷	..... شکل ۴-۸-ج- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر روی در $ZnO:Co$
۸۸	..... شکل ۴-۸-د- نمودار های چگالی حالات اسپین بالا و پایین برای عنصر کالت در $ZnO:Co$
۸۹	..... جدول ۴-۱- مقادیر ممانهای مغناطیسی محاسبه شده

# پیشگفتار

## پیشگفتار

سطح زمین تقریباً به طور کلی پوشیده از اکسیدها می باشد. قرنها کوشش شده است تا فلزاتی همانند مس، آلمینیوم و آهن را از احیا کردن این اکسیدها بدبست اورند. فلزات می توانند جریان الکتریکی را انتقال دهند و چکش خوار هستند، در حالیکه اکسیدها به طور کلی عایق اند و ترد و شکننده می باشند. اما در واقع هنگامی که خواص الکتریکی آنها مورد توجه قرار گرفت، دریافتند که آنها رساناهای بسیار خوبی هستند، تا آنجا که اکسید مس- تالیوم در دمای  $125\text{ K}$  خاصیت ابر رسانایی از خود نشان می دهد. بنابراین اکسیدها یک محدوده رسانندگی از عایق ها رساناهای فلزی و حتی ابر رساناهای را پوشش می دهند. با وجود این آنها را از نظر فن آوری همانند سیلیسیوم، مس و مواد دیگر استفاده نکرده اند و کاربرد آنها به میزان زیادی محدود به استفاده همانند ماده عایق شده است.

نیم رساناهای مغناطیسی رقیق ، نقش بسیار مهمی در علم اسپینترونیک دارند. در این علم توجه اصلی به ساخت موادی کاربردی ، مبتنی بر جهت دهی فرومغناطیسی ها به وسیله میدان الکتریکی است. در علم اسپینترونیک، سعی می شود از بار الکتریکی و اسپین الکترون ها ، هم زمان استفاده شود.

طول زیاد همدوسي اسپین الکترون ها، این امکان را به ما می دهد که از حرکت اسپین همانند بار الکتریکی برای انتقال اطلاعات استفاده شود. ادواتی که از قطبش الکترون استفاده می کنند اندازه کوچک تر و مصرف توان کمتر دارند و برای برخی سیستم های پردازش و محاسبه ، از ادواتی که فقط از بار الکتریکی استفاده می کنند مؤثرترند.

بسیاری از مصارف مغناطیسی مانند هد ادوات ذخیره اطلاعات ، به فلزات فرومغناطیس وابسته اند. توسعه نیمه رساناهای فرومغناطیسی که با فرآیندهای رشد استاندارد سازگار باشند، فضای بسیار وسیعی را پیش روی محققان باز می کند. در ساختار DMS تبادل بین الکترون های  $d$  قرارگرفته بر یون های مغناطیسی، و الکترون های  $sp$  تراز رسانش ، اتفاق می افتد. به همین دلیل ماده خواص غیر معمول مغناطیسی، نوری و مغناطیسی-نوری پیدا می کند.

نوع p نیم رساناهاي مغناطيسی رقيق بر پایه ZnO و GaN ، در صورت آلايش با Mn می توانند به خاصیت مغناطیسی در دمای بالای دمای اتانق برسند و در صورت آلاییده شدن با Co ، نوع n آنها می تواند خاصیت مغناطیسی بزرگی در دمای بالاتر از دمای اتانق بدهد.

در سال ۱۹۹۹ فلدرلینگ و اونو از DMS به عنوان قطبی کننده های اسپین برای کنترل قطبش نور در یک پیوند p-i-n استفاده کردند ولی چنین موادی فقط در دماهای پایین کار می کنند زیرا دمای کوری،  $T_c$  پایینی دارند. علاقه زیادی به اکسید روی برای این کاربرد به وجود آمده است زیرا بر اساس پژوهش های نظری انتظار می رود اکسید روی در صورت آلايش با عناصر واسطه بتواند خاصیت مغناطیسی با  $T_c$  بالا در حد دمای اتانق پیدا کند و بتواند با مدارات الکترونیکی امروزی سازگار شود. در شکل ۱-۳ این نتایج برای مواد مختلف آمده و نشان می دهد اکسید روی و GaN قابلیت زیادی برای استفاده در DMS دارند.

اکسید روی می تواند برای ترکیب با عناصر وابسته بسیار مناسب باشد زیرا ظرفیت (2+) Zn سازگاری خوبی در ترکیب با این عناصر دارد. این عامل باعث می شود بتوان به چگالی ناخالصی بیشتری رسید.

در این پایان نامه ،

در فصل اول به معرفی اکسیدهای رسانایی شفاف، به ویژه اکسید روی و همچنین نیمرساناهاي مغناطیسی رقيق می پردازیم و تاریخچه ای از آنها را بیان می کنیم

در فصل دوم مروری بر رهیافت‌های نظری در فیزیک ماده چگال داریم

در فصل سوم چگونگی بکارگیری نرم افزار Wien2k را در این رساله شرح می دهیم

و در فصل چهارم به محاسبات انجام شده و نتایج بدست آمده می پردازیم

نتایج بدست آمده از این رساله تا کنون در کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷ پذیرفته شده است.

# فصل اول

## فصل اول: مقدمه

سطح زمین تقریباً به طور کلی پوشیده از اکسیدها می باشد. قرنها کوشش شده است تا فلزاتی همانند مس، آلمینیوم و آهن را از احیا کردن این اکسیدها بدبست آورند. فلزات می توانند جریان الکتریکی را انتقال دهند و چکش خوار هستند، در حالیکه اکسیدها به طور کلی عایق اند و ترد و شکننده می باشند. اما در واقع هنگامی که خواص الکتریکی آنها مورد توجه قرار گرفت، دریافتند که آنها رساناهای بسیار خوبی هستند، تا آنجا که اکسید مس- تالیوم در دمای K ۱۲۵ خاصیت ابر رسانایی از خود نشان می دهد. بنابر این اکسیدها یک محدوده رسانندگی از عایق ها تا رساناهای فلزی و حتی ابر رساناهای را پوشش می دهند. با وجود این آنها را از نظر فن آوری همانند سیلیسیوم، مس و مواد دیگر استفاده نکرده اند و کاربرد آنها به میزان زیادی محدود به استفاده همانند ماده عایق شده است.

### ۱- اکسیدهای رسانای شفاف

یک نوع از ترکیبات اکسیدی ، اکسیدهای رسانای شفاف<sup>۱</sup> می باشند. با توجه به دامنه گسترده کاربردهای آنها در صنعت و تحقیقات ، مطالعه لایه های این ترکیبات اکسیدی مورد توجه بسیاری از محققین می باشد. همانطور که از نام آنها بر می آید، اکسیدهای رسانای شفاف ضمن شفافیت نسبت به یک محدوده خاص از طیف نوری باید رسانای الکتریکی نیز باشند. با توجه به کاربردهای فراوان آنها در ادوات مختلف ، بهینه سازی عملکرد آنها مهم می باشد. اغلب این مواد ، رسانای نوع n هستند که دارای یک گاف نواری عریض ( $3\text{ev}$ ) می باشند و استعداد و قابلیت آلایش شدن تا بهگنی را دارند. البته اخیراً اکسیدهای رسانای شفاف نوع p نیز ساخته و مطالعه شده اند[۱]، اما اغلب این مواد نوع n هستند.

<sup>۱</sup> Transparent Conducting Oxide(TCO)

لایه های شفاف و رسانا از برخی اکسیدهای فلزی همانند اکسید کادمیوم، اکسید قلع و اکسید ایندیوم از مدت‌ها قبل شناخته شده‌اند. لایه های نازک از اکسید کادمیوم ( $\text{CaO}$ ) اولین بار در سال ۱۹۰۷ میلادی توسط بکر<sup>۱</sup> شناخته شد. فیلم‌های نازک ( $100\text{--}200\text{ }\mu\text{m}$ ) از فلزاتی همانند  $\text{Au}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Ag}$ ,  $\text{Fe}$ , ... نیز دارای خواص مشابهی هستند، اما این فیلم‌ها به طور کلی خیلی پایا نمی‌باشند و خواص آنها با زمان تغییر می‌کند. پوشش‌هایی بر پایه مواد نیمه هادی دارای کاربردهای بیشتری می‌باشند، چون پایداری و سختی آنها بهتر و بیشتر از این لایه‌های نازک است. استفاده از یک لایه اکسید رسانای شفاف روی سطح شیشه‌ها و عبور یک جریان الکتریکی از آنها مانع از یخ‌زدن و مه‌گرفتگی سطح شیشه می‌شود. استفاده از این شیشه‌ها در پنجره‌های اولین کاربرد این مواد می‌باشد، که در طول جنگ جهانی دوم امکان بمباران از ارتفاع بالا را فراهم می‌کرد. کشف این مواد تا بعد از جنگ جهانی به صورت راز باقی ماند و توسعه اساسی در چنین موادی فقط بعد از ۱۹۴۰ صورت گرفت.

اکسید رسانای شفاف یک نیمه هادی با گاف نواری پهن ( $>357\text{ }\mu\text{m}$ ) می‌باشد که دارای یک غلظت نسبتاً بالایی از الکترونهاست آزاد در نوار رسانش خود می‌باشد. این غلظت بالای حاملها یا از نقایض در ماده یا از آلاینده‌های غیر ذاتی ناشی می‌شود، که تراز های ناخالصی آنها نزدیک لب باند رسانش قرار می‌گیرد. این غلظت بالای الکترون حامل سبب جذب تابش الکترومغناطیس در ناحیه مرئی و ناحیه فروسرخ طیف الکترومغناطیس می‌شود. چون یک لایه اکسید رسانای شفاف باید ضرورتاً یک سازگاری را بین رسانندگی الکتریکی و تراکسیلندگی اپتیکی نشان دهد، یک تعادل دقیق بین خواص آن مورد نیاز است. افزایش غلظت حاملها و یا حرکت پذیری آنها هر دو سبب افزایش رسانندگی می‌شود. اما افزایش اولی موجب افزایش در جذب نور مرئی می‌شود. لیکن افزایش حرکت پذیری اثرات زیان آوری ندارد و نسبتاً بهترین عامل برای بهینه سازی عملکرد آنها می‌باشد. به منظور افزایش حرکت پذیری می‌توان عوامل پراکنده‌ی را از بین برده که در این مورد محدودیت وجود دارد، یا اینکه باید مواد جدیدی کشف کرد که این محدودیتها در آنها کمتر وجود داشته باشد.

سه مکانیسم پراکنده‌ی در این مواد مهم می‌باشند. پراکنده‌ی الکترونها توسط ارتعاشات شبکه (فونونها)، که عاملی است که در دماهای بالا بیشتر باعث کاهش رسانندگی می‌شود. مکانیسم بعدی، پراکنده‌ی توسط اتمهای ناخالصی است. به منظور افزایش رسانندگی می‌توان غلظت حاملها را افزایش داد و در واقع در این مواد همانطور که قبلاً توضیح داده شد، غلظت حاملها زیاد است. وجود اتمهای ناخالصی در شبکه باعث پراکنده شدن حاملها می‌شود و حرکت پذیری حاملها را کاهش می‌دهد. اما در واقع غلظت بالای الکترونها سبب پوشش یونهای ناخالصی می‌شود و

این یونهای به طور مثبت باردار شده یک ابری از الکترونها را اطراف خودشان جمع می کنند، بنابراین میدان الکتریکی آنها در نزدیکی این ابر محدود می شود. مکانیسم پراکنده‌گی دیگر نیز مربوط به مرز دانه ها می باشد.

جایگذاری یک کاتیون با ظرفیت بالاتر توسط یک ناخالصی در مواد اکسیدی، رسانندگی نوع  $n$  را افزایش می دهد، در حالیکه قرار دادن یک کاتیون با ظرفیت پایین تر یک حفره را ایجاد می کند که همانند یک تله در نیمه هادی نوع  $n$  عمل می کند و رسانندگی را کاهش می دهد. اثرات مشابهی نیز می تواند توسط آلایش با آنیونهای با ظرفیت بالاتر و پایین تر رخ دهد. مینامی<sup>1</sup> نشان داده است که آلاییدن اکسید روی توسط عناصری همانند ایتریم(Zr)، زیرکونیوم(Ti)، تیتانیوم(Ti)، و هافنیوم(Hf) یک الکترون ظرفیت همانند آلاینده های معمولتر، بور(B)، آلومینیوم(Al)، گالیوم(Ga) یا ایندیوم(In) را ایجاد نمی کند. با وجود این مقاومت ویژه ای در محدوده  $\Omega_{cm}^{-1}$  را بدست آورده است[۲]. این مشاهده با توجه به در نظر گرفتن شرح معمول از آلاینده های غیر ذاتی تا اندازه ای معملاً گونه است.

ولیکن با در نظر گرفتن اینکه این اکسید های اضافی شکل گرفته می توانند اکسیژن را از شبکه اکسید روی جذب کنند، بنابراین جاهای خالی اکسیژن را ایجاد می کنند، توجیه پذیر است و در واقع آلایش کردن سبب ایجاد جاهای خالی اکسیژن می شود. به عنوان مثال اضافه کردن ناخالصی Sb به اکسید قلع سبب تشکیل ماده ای می شود که می توان آن را در نماد یونی به صورت  $Sn^{+4}_{1-x} Sb^{+5}_x O^{-2}_{2-x}$  نشان داد، که الکترونها اضافی مسئول رسانایی می باشند. با

افزایش غلظت ناخالصی، تراز های ناخالصی اضافه شده به زیر باند رسانش تشکیل باند می دهد و با باند رسانش همپوشانی کرده و نیمه هادی تیهگن را تشکیل می دهد. این اثر در مورد جاهای خالی اکسیژن مربوط به انحراف از استوکیومتری نیز رخ می دهد، اما عمق تراز های ناخالصی بیشتر از اینها می باشند. در مورد اضافه کردن ناخالصی آنیونی باید به مساله جذب اپتیکی میان تراز های آنها و کمینه باند رسانش توجه داشت. انرژی یونیزاسیون دهنده ها با افزایش غلظت دهنده ها کاهش می یابد. پرسون<sup>2</sup> و باردین<sup>3</sup> مدلی را برای کاهش انرژی یونیزاسیون با افزایش غلظت دهنده ها افزايش می یابد، پیشنهاد کرده اند[۳].

اغلب کارهایی که تا کنون محققین مختلف انجام داده اند، بهتر کردن کیفیت این فیلمها می باشد تا اثرات مکانیسم های پراکنده‌گی را کاهش دهنده و با کنترل کردن فرآیند های لایه نشانی میزان انحراف از استوکیومتری را تحت کنترل خود در آورند و یا با آلایش با مواد مختلف غلظت حاملها را تغییر دهنند، که در همه این موارد به تحرک پذیری بالایی نرسیده اند.

Minami<sup>1</sup>  
Pearson<sup>2</sup>  
Bardeen<sup>3</sup>

دو روش انتخاب برای رسیدن به عملکرد بهتر وجود دارد: یا باید مواد جدیدی کشف و اصلاح شوند و یا راه های بهتری برای ساختن اکسیدهای رسانایی شفاف استفاده تا کنون پیدا کرد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مقالات به بهینه سازی فیلم های اکسید رسانایی شفاف اختصاص داده شده است، روش اول سودمند تر به نظر می رسد.

کار روی رشد و تحلیل لایه های اکسید نیمه هادی شفاف توسط بسیاری از محققین در زمان های مختلف مرور شده است. هالند<sup>[۴]</sup> کار در این حوزه را تا سال ۱۹۵۵ میلادی مرور کرده است.

ووسن<sup>[۵]</sup>، هیک<sup>[۶]</sup> و مارتون<sup>[۷]</sup> مرور های جامعی به کارهای آزمایشی صورت گرفته تا اواسط ۱۹۷۰ میلادی انجام داده اند.

منیفسیر<sup>[۸]</sup> جارزبسکی<sup>[۹]</sup>، چوپرا و جوشی<sup>[۱۰]</sup> بررسی های با جزئیات را در این حوزه تا اواخر ۱۹۸۰ میلادی گزارش کرده اند. اخیرا هامبرگ<sup>[۱۱]</sup> کار روی لایه های اکسید ایندیوم را به جزئیات، بویژه از نقطه نظر عملی مرور کرده است.

### ۱-۱-۱- اکسید رسانایی شفاف با ترکیبات دوتایی

اغلب مواد اکسید رسانایی شفافی که تا کنون ساخته شده اند از ترکیبات دوتایی می باشند. یک مزیت استفاده از ترکیبات دوتایی همانند مواد اکسید رسانایی شفاف اینست که تهیه و ترکیب آنها در لایه نشانی فیلم نسبتاً ساده تر از ترکیبات سه تایی و پیچیده تر می باشد. مهمترین ترکیباتی که تاکنون ساخته شده  $\text{In}_2\text{O}_۳$ ،  $\text{SnO}_۲$ ،  $\text{Cd}_۲\text{SnO}_۶$ ،  $(\text{ITO})\text{In}_۲\text{O}_۳$ ،  $\text{In}_۲\text{O}_۳$ ،  $\text{ZnO}$  می باشند. در این تحقیق، بحث بر روی ماده  $\text{ZnO}$  می باشد، بنابراین به جزئیات خواص فیزیکی  $\text{ZnO}$  پردازیم:

Holland	<sup>۱</sup>
Vossen	<sup>۲</sup>
Haacke and Marton	<sup>۳</sup>
Manifacier	<sup>۴</sup>
Jarzebski	<sup>۵</sup>
Chopra and Joshi	<sup>۶</sup>
Hamberg	<sup>۷</sup>

## ۲-۱- اکسید روی (ZnO)

لایه های نازک اکسید روی در سال های اخیر توجه زیادی را در الکترونیک و الکترونیک نوری به خود جلب کرده است. شکاف نواری پهن ، قابلیت آلایش با ناخالصی های مختلف و با غلظت بالا ، رسانایی الکتریکی قابل تنظیم از علیق تا رسانا خوب و نیز خاصیت پیزو الکتریک بلور آن از ویژگی هایی است که باعث شده اکسید روی، موضوع تحقیقات بسیاری در زمینه ادوات نوری ، الکتریکی ، مغناطیسی و پیزو الکتریک گردد. جمع شدن خواص مختلف در یک ماده ارزان ، آن را برای کاربردهای جدید مانند ادوات میکرو الکترومکانیک<sup>۱</sup>، MEMS بسیار مناسب کرده است. استفاده از لایه نازک اکسید روی، امکان مجتمع سازی ادوات صوتی و نوری را با مدارهای الکتریکی فراهم می کند. این امر و نیز ارزانی مواد اولیه و سادگی لایه نشانی ، در کاهش هزینه ها مؤثر خواهد بود. تولید بلور حجیم اکسید روی در مقایسه با تولید لایه نازک آن بسیار دشوار و پرهزینه است و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به همین دلیل سعی شده بر خواص و کاربردهای لایه نازک اکسید روی تاکید بیشتری شود.

## ۱-۲- کاربردهای اکسید روی

اگر روی در هوا تا نقطه جوش گرم شود، بخارات آن آتش می گیرد و با شعله ای سفید مایل به سبز می سوزد و اکسید روی تولید می کند. اکسید روی ، پودری سفید مایل به زرد و بسیار نرم ، همراه با سطح ویژه بسیار بالا است که در تولید رنگ روغنی سفید، دارو، لوازم آرایش و روغن های مختلف بکار می رود. بخش عده اکسید روی تولید شده در صنعت لاستیک سازی بکار می رود. این ترکیب در قلیاها و اسیدهای قوی قابل حل شدن است. از این ترکیب در مقادیر کوچک تر می توان به عنوان فلاکس بسیار فعال استفاده کرد و در مقادیر بیشتر خاصیت کریستالی از خود بروز می دهد. اکسید روی بطور کمی، مهمترین محصول شیمیایی با بنیان روی می باشد. اکسید روی که دارای بیشترین تقاضا در بین ترکیبات روی است را می توان با فرآیندهای متنوعی بصورت صنعتی تولید نمود. خلوص و کیفیت اکسید روی به روش تولید آن بستگی دارد. اکسید روی با خلوص بالا بصورت پودر در اتقا های رسوب، در جایی که ذرات با اندازه های مختلف از هم جدا می گردند، جمع می شود. این ماده عموماً به عنوان روی سفید شناخته می شود. در فرآیند مستقیم ماده خام استفاده شده، کانه روی یا محصولات جانبی روی بوده که همواره حاوی سرب می باشد. یک ماده کربن دار را با ماده خام حرارت می دهند که در نتیجه احیاء ، روی به صورت بخار احیا می شود. این ماده در هوا اکسید شده و به ذرات با اندازه مختلف تقسیم می شود. ماده اولیه جهت فرآیندهای شیمیایی

<sup>۱</sup> Micro Electro Mechanic Systems

مرطوب محلول های خالص شده روی است. کربنات یا هیدروکسید روی، ته نشین شده، سپس فیلتر شده، شستشو داده می شود و پس از خشک شدن در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد بصورت پودر استحصال می شود. انواع متنوع اکسید روی به عنوان محصول واسطه در تولید سایر مواد شیمیایی استفاده می شود. اکسید روی ته نشین شده دارای خواص رنگریزه ای نمی باشد و درجه های ویژه مانند اکسید روی ظرف در کاغذهای فتوکپی کاربرد دارد. اکسید روی به عنوان رنگریزه در رنگ های لاتکس محلول کاربرد فراوانی دارد. همچنین به دلیل دارا بودن خاصیت پوششی اپاسیتی در برابر اشعه ماده بنفش و ضریب شکست بالا، در صنایع رنگ سازی استفاده می شود که باعث افزایش پایداری رنگ است. کاربرد این ماده در کشاورزی به عنوان افزاینده و بارور کننده جهت جبران کمبود روی خاک از اهمیت کمتری برخوردار است. این اکسید جزئی از فرمولاسیون در صنعت شیشه، لعب کاری و سرامیک می باشد. این ماده بر روی نقطه ذوب، خواص نوری و الاستیک و همچنین رنگ و جلای شیشه ها تاثیر می گذارد و از اجزاء پودر صورت، رژ لب و کرم هایی است که در صنعت لوازم آرایشی کاربرد دارد، همچنین به صورت ورق در بدنه باطری های خشک، پوشش سقف صفحه های گراور عکاسی، جهت محافظت بدنه کشتی خطوط لوله و تاسیسات حفاری در دریا بکار می رود [۱۲].

مقادیر زیاد این اکسید در صنایع لاستیک سازی به عنوان فعال کننده و شتاب دهنده اصلی در صنعت محکم سازی لاستیک با گوگرد استفاده می شود. به علاوه این ماده یک ترکیب سرامیکی مهم برای کاربرد در سنسور های گازی، سلول های خورشیدی و وریستور ها است [۱۳].

از لحاظ فیزیکی این ترکیب یک عامل مقاوم کننده، یک هادی گرمایی، یک رنگدانه سفید و یک جذب کننده نور UV است [۱۴].

اکسید روی تامین کننده روی غذاهای حیوانی و نیز یک کود مکمل برای زمین هایی است که کمبود روی دارند. فعالیت شیمیایی آن در استفاده های دارویی مختلف و پیچیده است، ولی بر اساس فعالیت زیاد آن، استفاده ای روزافزون دارد. همچنین این ترکیب در امر تغذیه هم کاربرد دارد [۱۵].